

第四條 半導體製造業產生之空氣污染物應經密閉集氣系統收集，並應符合下表規定後始得排放：

| 空氣污染物 | 適用對象 | 排放標準 |
|-------------------------|------|-------------------------------------|
| 揮發性有機物 | 既存製程 | 排放削減率應達九十%或排放濃度十四 ppm 以下(以甲烷為計算基準)。 |
| | 新設製程 | 排放削減率應達九十五%或排放濃度十 ppm 以下(以甲烷為計算基準)。 |
| 硝酸、鹽酸、 磷酸、氫氟酸 及硫酸 | 既存製程 | 各污染物排放削減率應達九十五%或排放濃度零點五 ppm 以下。 |
| | 新設製程 | 各污染物排放削減率應達九十六%或排放濃度零點三 ppm 以下。 |

前項硝酸、鹽酸、磷酸、氫氟酸及硫酸等排放之廢氣，因安全之虞而無法證明符合前項標準時，應檢具相關證明文件佐證具備同等處理效果或較優之控制條件，向直轄市、縣（市）主管機關申請替代認可。